(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年5月27日(27.05.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/043961 A1

C07D 477/06, C07F 7/18

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014420

(22) 国際出願日:

2003年11月13日(13.11.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-330128

2002年11月13日(13.11.2002)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 鐘淵化 学工業株式会社 (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒530-8288 大阪府 大阪市 北区中之島 3 丁目 2 番 4 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西野 敬太 (NISHINO, Kelta) [JP/JP]; 〒676-8688 兵庫県 高砂市 高砂町宮前町 1-8 鐘淵化学工業株式会社高砂工業 所内 Hyogo (JP). 古賀 照義 (KOGA, Teruyoshi) [JP/JP]; 〒676-8688 兵庫県 高砂市 高砂町宮前町 1-8 鐘淵 化学工業株式会社高砂工業所内 Hyogo (JP).

- (74) 代理人: 安富康男, 外(YASUTOMI, Yasuo et al.); 〒 532-0011 大阪府 大阪市 淀川区西中島 5 丁目 4 番 20号 中央ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特 許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

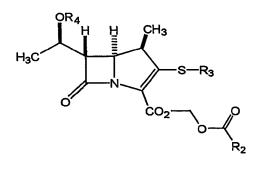
添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: PROCESS FOR PRODUCING CARBAPENEM COMPOUND FOR ORAL ADMINISTRATION
- (54) 発明の名称: 経口投与用カルパペネム化合物の製造方法

$$H_3C$$
 OR_1
 H_3C
 OR_2
 OR_1
 OR_3
 OR_2
 OR_3
 OR_3
 OR_4
 OR_3
 OR_4
 OR_5
 OR_5



(2)

(57) Abstract: A process for efficiently producing a 1 β -methylcarbapenem compound for oral administration. The process, which is for producing a 1 β -methylcarbapenem compound represented by the general formula (2), is characterized by reacting a β -lactam compound represented by the general formula (1) as a starting material with a thiol compound (R₃-SH) in the presence of a base and optionally eliminating the protective group R_1 . (1) (2) (In the formulae, R_1 represents hydrogen, trimethylsilyl, or triethylsilyl; R_2 represents C_{1-10} alkyl or C_{3-10} cycloalkyl; R_3 represents an organic group; and R_4 represents hydrogen, trimethylsilyl, or triethylsilyl.)

(57) 要約:

本発明は、経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物の効率的な製造方法を提供する。つまり、本発明は、一般式(1)で表される β -ラクタム化合物を出発原料とし、塩基の存在下にチオール化合物(R_3 -SH)と反応させ、必要に応じて保護基 R_1 を脱保護することを特徴とする、一般式(2)で表される 1β -メチルカルバペネム化合物の製造方法である。

$$H_3C$$
 CO_2
 CO_2

(式中、 R_1 : 水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基、 R_2 : 炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基または炭素数 $3 \sim 10$ のシクロアルキル基、 R_3 : 有機基、 R_4 : 水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示す)

明細書

経口投与用カルバペネム化合物の製造方法

技術分野

5 本発明は経口投与用1βーメチルカルバペネム化合物の効率的かつ極めて有用な製造方法に関する。

背景技術

1 βーメチルカルバペネム化合物は広範囲の病原菌に対して優れた抗菌作用を 10 示し、かつ生体内での安定性にも優れていることから最も注目されている抗菌剤 のひとつである。そのため、近年、経口投与用薬剤の研究開発が精力的に進めら れている。経口投与用1 βーメチルカルバペネム化合物の製造方法としては、現 在、以下のような方法が一般的に用いられている。

例えば、特開平8-53453号公報や、ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオ 15 ティックス(J. Antibiot.)、429~439頁、1997年に記載 されているように、式(6):

25 で表される化合物を各種チオール化合物 (R-SH) と反応させて、式 (7):

PCT/JP2003/014420

WO 2004/043961

(式中、Rはチオール残基を示す)で表される化合物を合成し、例えば加水素分解反応や、亜鉛末による還元反応により保護基であるpーニトロベンジル基を除10 去し、式(8):

$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C

(式中、Rはチオール残基を示す)で表される化合物に変換し、さらに得られた 化合物(8)のカルボン酸部位を例えばピバロイルオキシメチル化することによ り、式(9):

$$H_3C$$
 OH
 H
 H
 CH_3
 $S-R$
 CO_2
 O
 Bu^t

(式中、Rはチオール残基を示し、Bu t は te rt ープチル基を示す)で表される化合物を製造する方法である。

上記式(9)で表される化合物としては、例えば、前記特開平8-53453 号公報および特開平10-195076号公報には、式(10):

15

5

20

25

WO 2004/043961 PCT/JP2003/014420

$$H_3C$$
 OH
 H
 CH_3
 CO_2
 O
 Bu^t
 (10)

で示される化合物が記載されており、

5

15

20

25

また、前記ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオティックス(J. Antibiot.)、429~439頁、1997年および特開平10-130270号公報 10 には、式(11):

で示される化合物が記載されており、

さらに、特開平10-152491号公報には、式(12):

$$H_3C$$
 OH
 H
 H
 CH_3
 CO_2
 O
 Bu^t
 O
 O

で示される化合物が記載されているが、これらは全て上記方法にて合成されている。

しかしながら、これらの製造方法では経口投与用1βーメチルカルバペネム化

合物を合成するのに、カルボン酸保護基の付け換えを必要とし、多段階の反応を 経る必要があるため非効率的であり、また、最終物のチオール残基となる比較的 高価なチオール化合物を合成初期段階で用いることから、製造コスト面で不利と なり、問題となっていた。

5 また、特開平8-59663号公報および特開2000-344774号公報 には、式(13):

$$H_3C$$
 H_3C
 R_6
 R_7
 R_7
 R_7
 R_7

(式中、 R_5 は水酸基保護基を示し、 R_6 は生成物である 1β ーメチルカルバペ 15 ネム化合物中に含まれるチオール残基を示し、 R_7 は有機基を示す)で表される 化合物から、式(14):

$$H_3C$$
 H_3C
 R_6
 CH_3
 R_6
 CO_2
 CO_2
 R_7
 R_7
 CH_3
 R_6
 CH_3
 R_6
 CO_2
 R_7

20

(式中、 R_5 、 R_6 、 R_7 は前記と同じ意味を示し、 R_8 、 R_9 、 R_0 は全て炭素数 $1\sim 4$ の低級アルコキシ基であるか、あるいはひとつが炭素数 $1\sim 4$ のアルキル 基で残りふたつが炭素数 $1\sim 4$ の低級アルコキシ基を示す)で表される化合物を 合成し、これを環化させることにより、式(15):

15

20

$$H_3C$$
 OR_5
 H
 H
 CH_3
 $S-R_6$
 CO_2
 O
 O
 R_7

(式中、 R_5 、 R_6 、 R_7 は前記と同じ意味を示す)で表される化合物を製造する方法が記載されている。

10 しかしながら、本製造方法においても先述と同様に、最終物のチオール残基となる比較的高価なチオール化合物を合成初期段階で用いることから、製造コスト面で不利であり問題となっていた。

また、ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem)、第61巻、7889~7894頁、1996年、および特開平5-279367号公報には、式 (16):

$$H_3C$$

$$H_3C$$

$$CO_2$$

$$O$$

$$Bu^t$$

$$(16)$$

(式中、Meはメチル基を示し、Bu^tは前記と同じ意味を示す)で示される化 25 合物が記載されており、該化合物を各種チオール化合物との反応及び水酸基の脱保護により1β-メチルカルバペネム化合物に導くことが考え得る。しかしながら、上記化合物(16)においては、水酸基の保護基がtertープチルジメチルシリル基であるため、Protective Groups in Organic Synthesis(J Wiley & Sons, New Yor

k)、44~46頁、1981年に例示されているように、水酸基部位の脱保護には他の官能基に影響を及ぼすような反応試剤を使用する必要があり、収率等の点で問題がある。本発明者らは脱保護の方法を種々検討したが、容易かつ効率の良い脱保護を行うことは困難であった。

5 以上のような状況の中、経口投与用1βーメチルカルバペネム化合物の効率的 かつ製造コスト面で有利な製造方法の開発が望まれていた。

発明の要約

上記現状を鑑み、本発明者らは経口投与用1 β - メチルカルバペネム化合物の 10 合成において、最終段階にて一段でチオール化合物が導入できるような製造方法 の開発に関して鋭意検討した結果、本発明に至った。

即ち、本発明は、一般式(1):

$$H_3C$$

$$H_3C$$

$$CO_2$$

$$CO_2$$

$$R_2$$

$$(1)$$

20 (式中、 R_1 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示し、 R_2 は炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基または炭素数 $3 \sim 10$ のシクロアルキル基を示す)で表される化合物と、一般式(3):

$$R_3$$
—SH (3)

25 (式中、 R_3 は有機基を示す)で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応 させ、必要に応じて保護基 \dot{R}_1 を脱保護することを特徴とする、一般式 (2):

$$H_3$$
C
 OR_4
 H
 CH_3
 $S-R_3$
 CO_2
 O
 R_2

(式中、 R_2 、 R_3 は前記と同じ意味を示し、 R_4 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示す)で表される化合物の製造方法である。

10 発明の詳細な開示

5

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明は、一般式(1):

$$H_3C$$

$$H_3C$$

$$CO_2$$

$$CO_2$$

$$CO_2$$

$$R_2$$

$$(1)$$

20 で表される化合物と、一般式(3):

$$R_3$$
—SH (3)

で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応させ、必要に応じて保護基 R_1 を脱保護することを特徴とする、一般式(2):

25

PCT/JP2003/014420

5

10

15

20

25

$$R_{3}$$
C R_{3} R_{2} R_{2}

で表される化合物の製造方法である。

まず、各化合物における置換基について説明する。置換基 R_1 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示す。置換基 R_1 が水素原子である場合には、置換基 R_4 が水素原子である化合物(2)が得られる。一方、置換基 R_1 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(1)からは、置換基 R_4 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(2)が生成する。この場合、生成物として得られる置換基 R_4 を持つ化合物(2)は、従来知られている前記式(1 6)で表される化合物とは異なり、容易に水酸基を脱保護することが可能であり、置換基 R_4 が水素原子である化合物(2)を得ることができる。置換基 R_1 は、生成物として得られる化合物(2)の脱保護反応に対して、化合物中の他の官能基部分を極力分解させることなく、穏和な反応条件にて除去できるものとして選定されている。脱保護を容易なものとするため、置換基 R_1 が水酸基保護基である場合には、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である必要があり、トリメチルシリル基が特に好ましい。

置換基 R_2 は最終的に経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物として開発されうる化合物中のカルボン酸エステル残基のアルカノイルオキシメチル基部位に含まれてくるものであり、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基または炭素数 $3\sim10$ のシクロアルキル基を示す。

炭素数1~10のアルキル基の例としてはメチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプロピル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertープチル基、ノルマルオクチル基、ノルマルデカニル基等が挙げられる。 炭素数3~10のシクロアルキル基は置換基を有していてもよく、置換基としてはメチル基、エチル基等の炭素数1~4のアルキル基等が挙げられる。 炭素数

3~10のシクロアルキル基の例としてはシクロプロピル基、シクロヘキシル基、 1-メチルシクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

置換基R₂としては、なかでも経口投与用カルバペネム化合物の開発でよく使用されるtertーブチル基が特に好ましい。

5 置換基 R_3 は有機基を示し、最終的に経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物として開発されうる化合物中のチオール残基に含まれてくるものが好ましい。より好ましくは、一般式(3):

$$R_3$$
—SH (3)

10 (式中、R₃は有機基を示す)で表されるチオール化合物のチオール残基として、 次式(4):

$$HS \longrightarrow N \longrightarrow N$$
 (4)

で示される、特開平8-53453号公報に記載の化合物のチオール残基、次式 15 (5):

で示される、ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオティックス (J. Antibi 20 ot.)、429~439頁、1997年に記載の化合物のチオール残基、次式 (19):

25 で示される、特開平10-152491号公報に記載の化合物のチオール残基等 が挙げられる。

置換基R₃として、好ましくは式(4)で示される化合物のチオール残基、式(5)で示される化合物のチオール残基である。

置換基R₄は、水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示

し、上述したように、置換基R₄がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル 基である場合には、必要に応じ、脱保護を行うことにより、容易に経口投与用1 β-メチルカルバペネム化合物を得ることができる。

次に本発明の製造方法について説明する。

5 本発明において使用される出発原料の前記式(1)で表される化合物は、下記式(17):

$$H_3C$$
 OH
 H
 H
 H
 N
 O
 R'
 $COOH$
 $COOH$

10

15

(式中、R' は置換基を有していてもよいアリール基またはヘテロアリール基を示す)で表される化合物から誘導でき、その一例を後記参考例 $1\sim 4$ として詳細に記載した。なお、上記式(1 7)で表される化合物は、ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブルティン(Chem.Pharm.Bull.)、4 2巻、 $1381\sim 1387$ 頁、1994 年の記載に従い、容易に調製可能である。上記化合物(1)と、前記式(3)で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応させることにより、前記式(2)で表される 1β - メチルカルバペネム化合物が得られる。

該反応は化合物(1)を分解させないような不活性溶媒を用いて行われる。不活性溶媒としては特に限定はされないが、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒;N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド等のアミド系溶媒;ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、アセトン、塩化メチレン、およびそれらの混合溶媒等が挙げられる。反応速度の点から、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、アセトニトリルが特に好ましい。

反応に使用されるチオール化合物(3)の量は、化合物(1)に対して、1. 0倍モル量以上必要であり、好ましくは1.1 \sim 3.0倍モル量である。また、 チオール化合物(3)は、塩酸塩等の塩を形成していてもよい。

また、使用される塩基としては、有機アミン類、アルカリ金属塩、アルカリ金属アルコキシド、アルカリ金属アミド、アルカリ金属水素化物等が挙げられる。

有機アミン類としては、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、4 ージメチルアミノピリジン、1,8ージアザビシクロ [5.4.0] ーウンデシー7ーエン(DBU)、1,5ージアザビシクロ [4.3.0] ーノンー5ーエン(DBN)、1,4ージアザビシクロ [2.2.2] オクタン(DABCO)等が例示される。有機アミン類を使用する場合には、その使用量は化合物(1)に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~3.0倍モル量が好ましい。

10 アルカリ金属塩としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の 炭酸アルカリ塩;重炭酸ナトリウム、重炭酸カリウム等の重炭酸アルカリ塩等が 例示される。その使用量は化合物(1)に対し、炭酸アルカリ塩使用時には0. 5倍モル量以上が必要であり、重炭酸アルカリ塩使用時には1.0倍モル量以上 が必要であるが、共に1.1~2.0倍モル量が好ましい。

15 アルカリ金属アルコキシドとしては、カリウムtertーブトキシド、ナトリウムtertープトキシド等が例示される。アルカリ金属アルコキシドを使用する場合には、その使用量は化合物(1)に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~2.0倍モル量が好ましい。

アルカリ金属アミドとしては、リチウムビス (トリメチルシリル) アミド、ナ 20 トリウムビス (トリメチルシリル) アミド、カリウムビス (トリメチルシリル) アミド等が例示される。アルカリ金属アミドを使用する場合には、その使用量は 化合物 (1) に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~2.0倍モル量 が好ましい。

アルカリ金属水素化物としては、水素化ナトリウム、水素化カリウム等が例示 25 される。アルカリ金属水素化物を使用する場合には、その使用量は化合物 (1) に対し1.0倍モル量以上が必要であり、1.1~2.0倍モル量が好ましい。

上記反応は通常 $-78\sim60$ ℃で実施されるが、反応物、生成物の分解抑制の理由から $-40\sim40$ ℃で行うのが好ましい。

また、反応時間は通常5分~40時間であるが、上記理由から1~30時間で

あることが好ましい。

10

15

また、当然のことではあるが、薄層クロマトグラフィー(TLC)、高速液体 クロマトグラフィー(HPLC)といった分析的手段により該反応の経時変化を 知ることができる。

5 反応後の混合物から、通常有機反応においてしばしば用いられるpH調節、抽 出、分液、洗浄、濃縮、精製などの操作を経て、目的化合物(2)を単離するこ とができる。

化合物(1)の置換基 R_1 が水素原子である場合には、上記反応にて、置換基 R_4 が水素原子である化合物(2)が得られ、直接、経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物を合成することができる。

一方、置換基 R_1 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である場合には、それぞれ置換基 R_4 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(2)へと誘導される。置換基 R_1 が上記の水酸基保護基(トリメチルシリル基又はトリエチルシリル基)である場合には、容易に離脱できる置換基として選定されているため、反応後の混合物から抽出、洗浄などの操作にてp H調節を行う際、酸性条件とすることで水酸基部位の脱保護を同時に行うことができ、置換基 R_4 がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である化合物(2)から、容易に置換基 R_4 が水素原子である化合物(2)へと変換され、経口投与用1 β -メチルカルバペネム化合物を取得することができる。

20 上記で使用される酸性条件はpHが7以下の条件であれば特に制限はないが、pH2~6であることが好ましく、該pHにて該水酸基保護基が極めて容易に離脱される。また、当該酸性条件とするために、例えば、クエン酸水、塩酸等を抽出液等に添加することができる。

また、置換基R₄がトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基である場合、 25 化合物(2)を一旦取り出してから、別途脱保護を行ってもよく、この場合の脱 保護方法としては、上記方法に加えて、例えば、Protective Gro ups in Organic Synthesis (J Wiley & S ons, New York)、39~50頁、1981年に記載されているよう な、一般的なシリル保護基の脱保護条件を採用することができる。

10

本発明により、式(1)で示される化合物と、式(3)で示されるチオール化合物から、式(2)で示される 1β ーメチルカルバペネム化合物を、短段階にて効率的かつ容易に合成することができる。本発明は、式(3)で示されるチオール化合物として特に式(4)および(5)で示されるチオール化合物を用い、それぞれ式(10);

(式中、Bu^tはtertーブチル基を示す)、および、式(11);

$$H_3C$$

$$H_3C$$

$$CO_2$$

$$O$$

$$NH$$

$$CH_3$$

$$NH$$

$$CH_3$$

$$NH$$

$$CO_2$$

$$O$$

$$R_U^{\dagger}$$

(式中、Bu^tは前記と同じ意味を示す)で示される経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物を合成する方法として好ましいものである。

25 発明を実施するための最良の形態

以下に実施例および参考例を挙げてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの記載によって何ら限定されるものではない。なお、以下の実施例および参考例で用いた略号の意味は次のとおりである。

Me:メチル基

PCT/JP2003/014420 WO 2004/043961

14

Bu^t:tertーブチル基

TMS: トリメチルシリル基

TES: トリエチルシリル基

(3S, 4S) -4- [(1R) -1- (p-クロロフェニルチ 5 オカルボニル) エチル] -3-[(1R) -1-ヒドロキシエチル] -1-ピバ ロイルオキシメチルオキシカルボニルメチルー2ーアゼチジノンの製造

(3S, 4S) -1-カルボキシメチル-4-[(1R) -1-(p-クロロ フェニルチオカルボニル) エチル]-3-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-2-アゼチジノン8.18g(22.0mmol)をジメチルホルムアミド115 8mlに室温で溶解させ、塩化ピバロイルオキシメチル5.5ml (40.0m mo1)、ヨウ化ナトリウム5.75g(40.3mmo1)を順次添加し、ジ イソプロピルエチルアミン4.2m1(25.3mmol)を滴下した後、同温 度で20時間攪拌した。反応液をトルエン120m1で希釈し、2.5%重曹水 および水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を、芒硝にて乾燥させた後、溶媒 20 を留去した。得られた油状残渣を室温でトルエン60mlに溶解し、ヘキサン1 20m1を添加すると結晶が析出した。これをろ別、洗浄することにより標記の 白色結晶 9. 46 g を得た(収率 92. 7%)。

NMR δ (CDC1₃): 1. 19 (9H, s), 1. 32~1. 34 (6H, m) $\sqrt{3}$. 11 \sim 3. 18 (2H, m) $\sqrt{3}$. 87 (1H, d, J=18. 1H 25 z) $\langle 4.15 (1H, dd, J=2.4, 4.4Hz) \langle 4.22 \sim 4.24$ (1H, m), 4. 35 (1H, d, J=18.1Hz), 5. 76 (2H, s)), 7. 31 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 40 (2H, d, J=8.8Hz)

20

(参考例 2) (4R, 5R, 6S) - 6 - [(1R) - 1 - h リメチルシリロ キシエチル] -3 - ジフェニルホスホリロキシ-4 - メチルー 7 - オキソー1 - アザビシクロ <math>[3. 2. 0] ヘプトー2 - エンー2 - カルボン酸ピバロイルオキ シメチルエステルの製造

参考例1と同様にして合成した(3S, 4S) -4-[(1R) -1-(p-クロロフェニルチオカルボニル)エチル] -3-[(1R) -1-ヒドロキシエチル] -1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチルー2ーアゼチジノン1.997g(4.1mmo1)をトルエン20m1に溶解させ、室温にてトリエチルアミン0.88mL(6.4mmo1)を加え、塩化トリメチルシラン0.78mL(6.2mmo1)を滴下した後、同温度で15時間攪拌した。反応液をトルエン5m1で希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

25 得られた油状残渣 2. 6 3 g にテトラヒドロフラン 2 2. 5 m 1 を加えて溶解させ、-70℃まで冷却し、カリウム t e r t ープトキシドを 0. 9 5 6 g (8. 5 m m o 1) 添加後、1 5 分攪拌した。次いで同温度でヨウ化メチル 0. 2 6 m L (4. 2 m m o 1) を添加し、-35℃まで徐々に昇温しながら 2 5 分攪拌後、続けて-35℃にて塩化ジフェニルリン酸 1. 0 m L (4. 9 m m o 1) を添加

し、-9℃まで徐々に昇温しながら1.8時間攪拌した。反応液をトルエン20mlで希釈し、氷冷下に2.5%重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を 芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去して標記化合物を得た。

反応時の経時変化を追跡する手段として高速液体クロマトグラフィーにて分析を行ったが、反応液および得られた標記化合物をアセトニトリル/水/リン酸=700/300/1で混合した溶離液に溶解させ分析を行ったところ、参考例3で述べる生成物と同じ保持時間に検出されたことから、水酸基保護基であるトリメチルシリル基が容易に脱保護されることを確認した。

NMR δ (CDC l_3): 0. 11 (9H, s), 1. 19 \sim 1. 29 (15H, 10 m), 3. 24 (1H, dd, J=2. 9, 6. 6Hz), 3. 45 \sim 3. 50 (1H, m), 4. 07 \sim 4. 19 (2H, m), 5. 78 (1H, d, J=5. 5Hz), 5. 81 (1H, d, J=5. 5Hz), 7. 15 \sim 7. 40 (12 H, m)

15 (参考例3) <u>(4R, 5R, 6S) - 6 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル</u>] <u>- 3 - ジフェニルホスホリロキシー 4 - メチルー 7 - オキソー 1 - アザビシクロ[3.2.0] ヘプトー 2 - エンー 2 - カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造</u>

20
$$H_3$$
C H_3

WO 2004/043961 PCT/JP2003/014420

17

参考例1と同様にして合成した(3 S, 4 S) $-4-[(1R)-1-(p-2\pi)]$ クロロフェニルチオカルボニル)エチル] -3-[(1R)-1-1] ドロキシエチル] -1-1 ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチルー2ーアゼチジノン0.97g(2.0 mmol)をトルエン5 mlに溶解させ、室温にてトリエチルアミン0.50g(5.0 mmol)を加え、塩化トリメチルシラン0.39g(3.6 mmol)を滴下した後、同温度で15時間攪拌した。反応液をトルエンで希釈し、水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣にテトラヒドロフランとトルエンの体積比が 1 対 2 である混 10 合溶媒 1 5 m 1 を加えて溶解させ、-25℃まで冷却し、カリウムtertーブトキシドを 0.475g(4.2 mmol)添加後、1 時間攪拌した。次いで同温度でヨウ化メチル 0.30g(2.1 mmol)を添加し、20分攪拌後、続けて塩化ジフェニルリン酸 0.60g(2.2 mmol)を添加し、2.5時間攪拌した。

15 反応液を氷冷下に酢酸エチルと水を添加し、1 N塩酸水にて混合溶液の p H を 3 として分離した酢酸エチル溶液を、重曹水および水で数回洗浄した後、芒硝に より乾燥させ、溶媒を留去して標記化合物を得た。

NMR δ (CDC1₃): 1. 18~1. 20 (12H, m), 1. 29 (3H, d, J=4. 9Hz), 3. 28 (1H, dd, J=2. 4, 6. 3Hz), 3. 45~3. 51 (1H, m), 4. 17~4. 21 (2H, m), 5. 77 (1H, d, J=5. 5Hz), 5. 81 (1H, d, J=5. 5Hz), 7. 21~7. 40 (12H, m)

20

参考例1と同様にして合成した(3 S, 4 S) -4-[(1R)-1-(p-2)] クロロフェニルチオカルボニル)エチル]-3-[(1R)-1-1] ドロキシエチル]-1-1 デロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル-2-7 デジノン0. 493g(1.0 mmo 1)をトルエン10m1に溶解させ、室温にてトリエチルアミン0.17g(1.7 mmo 1)を加え、塩化トリエチルシラン0.24g(1.6 mmo 1)を滴下した後、同温度で22時間攪拌した。反応液をトルエン10m1で希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

20 得られた油状残渣にテトラヒドロフラン6m1を加えて溶解させ、-25℃まで冷却し、カリウムtertーブトキシドを0.232g(2.1mmo1)添加後、60分攪拌した。次いで同温度で臭化ベンジル0.19g(1.05mmo1)を添加し、20分攪拌後、続けて塩化ジフェニルリン酸0.30g(1.1mmo1)を添加し、2時間攪拌した。反応液をトルエン50m1で希釈し、25 沐冷下に2.5%重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去して標記化合物を得た。

NMR δ (CDC1₃): 0. 59 \sim 0. 62 (6H, m), 0. 94 (9H, t, J=8. 1Hz), 1. 19 \sim 1. 28 (15H, m), 3. 23 (1H, dd, J=2. 9, 6. 6Hz), 3. 42 \sim 3. 46 (1H, m), 4. 13

(1H, dd, J=2. 9, 10. 3Hz), 4. $18\sim4$. 23 (1H, m), 5. 78 (1H, d, J=5. 5Hz), 5. 81 (1H, d, J=5. 5Hz), 7. $15\sim7$. 43 (12H, m)

5 (実施例1) ピバロイルオキシメチル (1R, 5S, 6S) -2- [1-(1, 3-チアゾリン-2-イル) アゼチジン-3-イル] チオー6- [(1R) -1 -ヒドロキシエチル] -1-メチルーカルバペン-2-エム-3-カルボキシレートの製造

15

20 参考例2にて合成した(4R,5R,6S)-6-[(1R)-1-トリメチルシリロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリロキシー4-メチルー7-オキソー1-アザビシクロ[3.2.0]へプトー2-エンー2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む黄色油状残渣4.53gをアセトニトリル15mlに溶解させ、式(18):

25

$$HS \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow MCI$$
 (18)

で示される化合物 1. 10g (5. 1 mm o 1) を添加し、氷冷下にジイソプロピルエチルアミン 1. 8 m l (10. 3 mm o 1) を滴下後、同温度にて 1. 9

時間攪拌した。反応終了後、溶媒を留去し、酢酸エチル40m1および水100m1を添加し、重炭酸カリウム水、重曹水により洗浄した。得られた酢酸エチル溶液にクエン酸水を加えて酸性とし水層に抽出した後、酢酸エチル50m1および重炭酸カリウムを添加して再度酢酸エチル層へと抽出した。本溶液を重量が12gとなるまで溶媒を留去し、これにヘプタン25m1添加すると結晶が析出した。これをろ別、洗浄することにより標記化合物を含む白色結晶1.87gを得た。

NMR δ (CDC1₃): 1. 23 (9H, s), 1. 23 (3H, d, J=7. 1), 1. 34 (3H, d, J=6. 4Hz), 3. 13 \sim 3. 21 (1H, m) 10), 3. 23 (1H, dd, J=2. 7, 6. 8Hz), 3. 37 (2H, t, J=7. 6Hz), 3. 94 \sim 4. 03 (4H, m), 4. 10 \sim 4. 26 (3H, m), 4. 36 \sim 4. 42 (2H, m), 5. 84 (1H, d, J=5. 5Hz)

15 (実施例2) <u>ピバロイルオキシメチル(1R,5S,6S)-2-[1-(1,3-チアゾリン-2-イル)アゼチジン-3-イル</u>]チオ-6-[(1R)-1 ーヒドロキシエチル]-1-メチルーカルバペン-2-エム-3-カルボキシレートの製造

参考例3と同様にして合成し、精製した(4R,5R,6S)-6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリロキシー4-メチルー7ーオキソー1ーアザビシクロ[3.2.0]へプトー2-エンー2ーカルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む油状残渣0.32gをアセトニトリル1 mlに溶解させ、式(18):

HS
$$\sim$$
 N \sim HCI (18)

で示される化合物 0.07g(0.33mmol)を添加し、-10℃にてジイ 10 ソプロピルエチルアミン 0.09g(0.70mmol)を滴下後、同温度にて 3時間攪拌した。反応終了後、酢酸エチル 20ml および水 20ml を添加し、 クエン酸水を加えて水層へ抽出した後、酢酸エチル 20ml および重炭酸カリウ ムを添加して再度酢酸エチル層へと抽出した。本溶液を芒硝にて乾燥させた後、 溶媒を留去し、NMR分析により標記化合物の生成を確認した。

15

(実施例3) $\frac{ \text{ピバロイルオキシメチル } (1\,\text{R}, 5\,\text{S}, 6\,\text{S}) - 2 - [(3\,\text{R}) }{ -5 - \text{オキソピロリジン} - 3 - \text{イル}] \mathcal{F} x - 6 - [(1\,\text{R}) - 1 - \text{ヒドロキシエ} }{ \mathcal{F} \nu] - 1 - \text{メチル} - \text{カルバペン} - 2 - \text{エム} - 3 - \text{カルボキシレ} - \text{トの製造}$

25

5

10

15

20

で示される化合物 0. 5 7 g (4.9 mm o 1) を添加し、5℃にてジイソプロピルエチルアミン 0. 7 9 g (6.1 mm o 1)を滴下後、同温度にて 7 0 分攪拌した。反応終了後、アセトニトリルを留去し、酢酸エチル 4 0 m 1 に溶解させ、重曹水にて数回洗浄することにより副生したジフェニルリン酸を除去した。得られた酢酸エチル溶液に水を添加後、1 Nの塩酸水を p H 3 となるまで加えた。分液操作により得られた酢酸エチル溶液を重曹水、水で洗浄した後、本溶液を芒硝にて乾燥させ、さらに溶媒を留去し、アセトン 2 0 m L に溶解させた。これにトルエン 3 0 m L を添加して、アセトン溶媒を徐々に留去し、白濁溶液となるのを確認した。この白濁溶液を 0~5℃にて1時間攪拌し、ろ別、洗浄することにより白色結晶を得た。再度、アセトンに溶解させ、上記同様、トルエン添加及び溶媒留去、攪拌、ろ別、洗浄の操作を経ることにより、標記化合物を含む白色結晶 0.70 g を得た。

NMR δ (CDC l_3): 1. 22 (9H, s), 1. 27 (3H, d, J=7. 1), 1. 32 (3H, d, J=6. 3Hz), 2. 39 (1H, dd, J=5. 1, 17. 1Hz), 2. 83 (1H, dd, J=8. 1, 17. 1Hz), 3. 26 (1H, dd, J=2. 4, 6. 8Hz), 3. 31~3. 36 (1H, m 25), 3. 84 (1H, dd, J=8. 1, 10. 7Hz), 4. 01~4. 06 (1H, m), 4. 22~4. 28 (2H, m), 5. 82 (1H, d, J=5. 5Hz), 5. 96 (1H, d, J=5. 5Hz)

(実施例4) <u>ピバロイルオキシメチル(1R, 5S, 6S) -2-[(3R)</u>

25

<u>-5-オキソピロリジン-3-イル</u>] チオー6-[(1R)-1-ヒドロキシエ チル] -1-メチル-カルバペン-2-エム-3-カルボキシレートの製造

で示される化合物 0.12g (1.0mmo1)を添加し、 $0\sim5$ \mathbb{C} にてジイソプロピルエチルアミン 0.13g (1.0mmo1)を滴下後、同温度にて 3時間攪拌した。反応終了後、トルエン、水20m1 ずつを添加し、1N の塩酸水をpH2 となるまで加えた。分液操作により得られたトルエン溶液を重曹水、水で洗浄した後、本溶液を芒硝にて乾燥させ、さらに溶媒を留去し、NMR 分析により標記化合物の生成を確認した。

産業上の利用可能性

WO 2004/043961 PCT/JP2003/014420

24

本発明により、近年活発に研究開発がなされている種々の経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物の効率的かつ容易な合成が可能となり、本発明は工業的に有用なものである。

WO 2004/043961 PCT/JP2003/014420

25 請求の範囲

1. 一般式(1):

5
$$H_3C$$

$$CO_2$$

$$R_2$$

$$(1)$$

(式中、 R_1 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示し、 R_2 は炭素数 $1\sim10$ のアルキル基または炭素数 $3\sim10$ のシクロアルキル基を示す)で表される化合物と、一般式 (3):

$$R_3$$
—SH (3)

(式中、 R_3 は有機基を示す)で表されるチオール化合物を塩基の存在下に反応させ、必要に応じて保護基 R_1 を脱保護することを特徴とする、一般式(2):

20
$$H_3C$$
 CO_2
 CO_2
 CO_2
 CO_2
 R_2
 R_2

- 25 (式中、 R_2 、 R_3 は前記と同じ意味を示し、 R_4 は水素原子、トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示す)で表される化合物の製造方法。
 - 2. R₂がtertープチル基である請求の範囲第1項に記載の製造方法。

3. R₃が式(4):

$$HS \longrightarrow N \longrightarrow N$$

- 5 で示されるチオール化合物のチオール残基である請求の範囲第1または2項に記載の製造方法。
 - 4. R₃が式(5):

で示されるチオール化合物のチオール残基である請求の範囲第1または2項に記載の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/14420

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 C07D447/06, C07F7/18						
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	SSEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07D447/06, C07F7/18						
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN/CAS						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X	4 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	1-2 3-4			
Y	& CA 2127193 A & EP & JP 8-53453 A & IL & ZA 6404720 A & NO & FI 955954 A & CA	943164 A 632039 A 116331 A	3			
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or understand the principle or theory underlying the invention can considered novel or cannot be considered to involve an invention of particular relevance; the claimed invention can considered novel or cannot be considered to involve an invention of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document is taken alone document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 09 February, 2004 (09.02.04) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cite understand the principle or theory underlying the invention can considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family "A" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cite understand the principle or theory underlying the invention can considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive			ne application but cited to enlying the invention claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be when the document is a documents, such a skilled in the art family			
	nailing address of the ISA/ Anese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/14420

tegory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 10-130270 A (Sankyo Co., Ltd.), 19 May, 1998 (19.05.98), (Family: none)	4
·		
		ļ
-		

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類'(IPC))

Int. Cl' C07D477/06, C07F7/18

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ C07D477/06, C07F7/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) STN/CAS

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
X Y	EP 559533 A1 (TANABE SEIYAKU CO.,LTD.) 1993.09.08 Claim 8, lines 8-33 of page 3, line 57 of page 4 to line 1 of page 5 & JP 5-279367A & CA 2085540 A & US 5414081 A & US 5589592 A	1-2 3-4		
Y	EP 632039 A1 (LEDERLE (JAPAN), Ltd.) 1995.01.04 & NO 942483 A & FI 943164 A & CA 2127193 A & EP 632039 A & JP 8-53453 A & IL 116331 A & ZA 6404720 A & NO 955007 A & FI 955954 A & CA 2164918 A & ZA 9510546 A & EP 717042 A,他	3		

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 09.02.2004 国際調査報告の発送日 24.2.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 中安 智 印 単便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3452 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/14420

C (続き) .	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	・引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 10-130270 A(三共株式会社)1998.05.19 (ファミリーなし)	4	
	·		
		·	